

第8回 総研セミナーのご案内

武蔵工業大学 総合研究所
所長 白木 靖寛

下記のとおり総研セミナーを開催いたします。
今回はシリコンナノ科学研究センターより、3件の話題を報告いたします。
多数の方々のご参加をお待ちしております。

記

日 時：平成19年2月15日（木）13時～15時

場 所：総合研究所コンファレンスホール

話題提供：① 武蔵工業大学 総合研究所 奥井 登志子

「Si/SiGe ヘテロ構造を観る」

② 山梨大学工学部 有元 圭介

「Si(110)基板上への高移動度歪み Si 薄膜形成に向けて」

② 産業技術総合研究所 宮田 典幸

「究極のハフニウム酸化膜を目指して：

ナノシリコンデバイスのための絶縁膜形成技術」

* 次回開催予定：平成19年3月13日（木）13時～

お問い合わせ先：総合研究所事務室 TEL 03-5706-3111